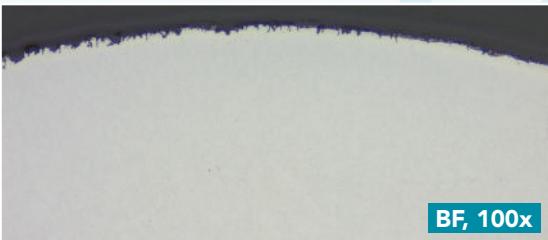
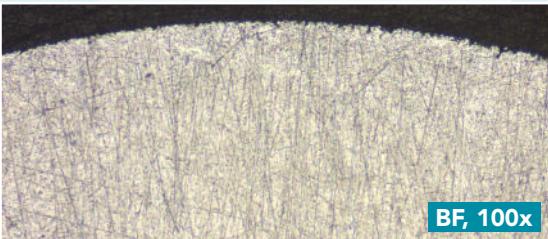
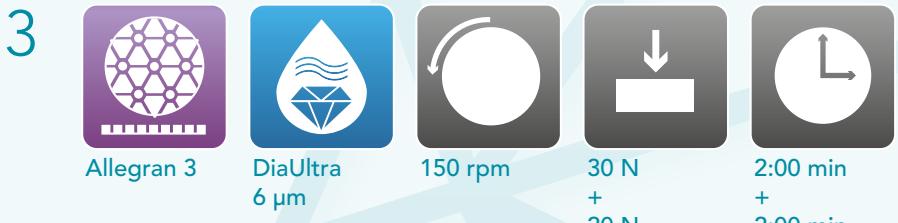
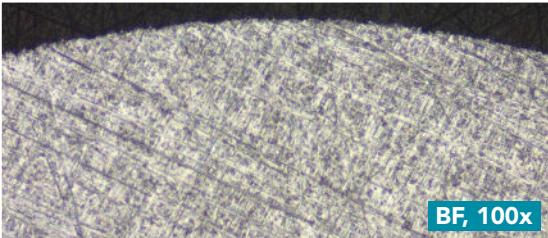
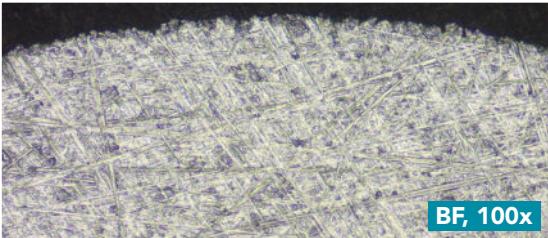


Aka-Brief #3 Titane Pure



Les temps sont indiqués pour un système de préparation de 300 mm et les forces pour un échantillon individuel de 40 mm de diamètre.

Sur un système de 250 mm, les temps doivent être augmentés de 30 %, sur un système de 200 mm de 100 %

La force doit être augmentée pour les échantillons plus grands et diminuée pour les échantillons plus petits.

La vitesse de rotation de la tête (porte-échantillon ou plaque porte-échantillon) utilisée est de 150 tr/min.

Le temps et la force peuvent varier en fonction de l'équipement.* Avant le polissage aux oxydes, le drap de polissage doit être mouillé avec de l'eau jusqu'à ce que le support touche le tissu de polissage.

Pendant les 10 secondes de l'étape de polissage aux oxydes, le tissu de polissage doit être

Le tissu de polissage doit être rincé à l'eau pendant les 10 secondes de l'étape de polissage à l'oxyde, afin de nettoyer à la fois le ou les échantillons et le tissu de polissage.

** 96 ml Fumed Silica, 2 ml H₂O₂ (30%), 2 ml NaOH (10%)

Le mélange doit être utilisé frais (dans les deux heures qui suivent) et remué régulièrement.

Veillez à prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires lors de la manipulation des produits chimiques.

SQMECO

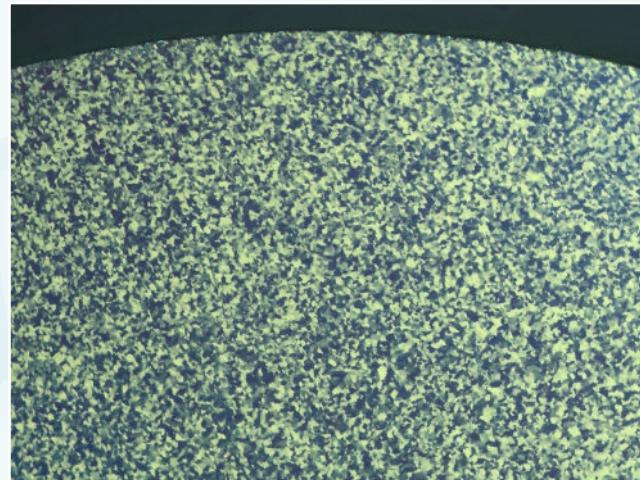
Aka-Brief #3 Titane Pure

SOMEKO

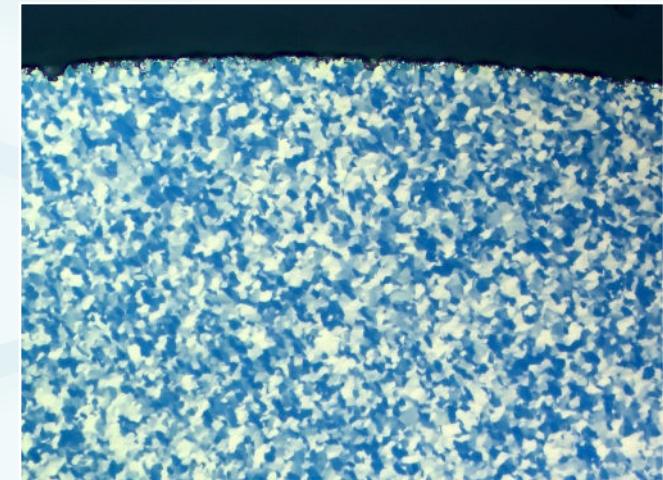
RÉSULTAT FINAL



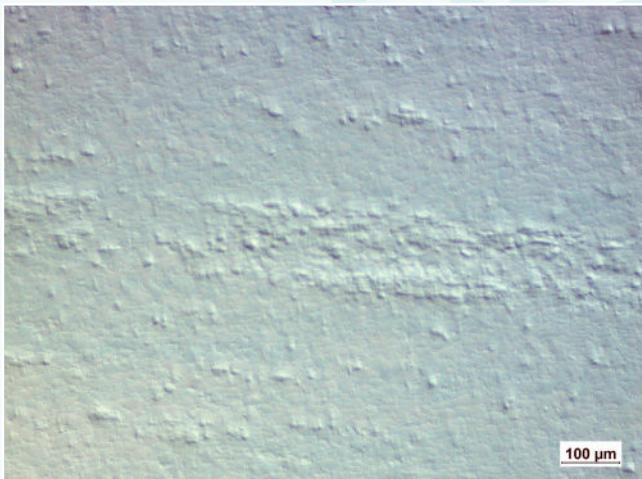
Pure Titanium, Grade 4, DIC, 100x



Pure Titanium, Grade 4,
POL + Lambda Compensator, 100x



Pure Titanium, Grade 4,
POL + Lambda Compensator, 200x



Pure Titanium, Grade 2, DIC, 100x



Pure Titanium, Grade 2,
POL + Lambda Compensator, 100x



Pure Titanium, Grade 2,
POL + Lambda Compensator, 200x